基於透明薄膜之氨氣感測器製作及傳輸方法之 研究

林坤緯

朝陽科技大學資訊工程系 副教授 kwlin@cyut.edu.tw

胡舜皓

朝陽科技大學資訊工程系研究生 s10227609@gm.cyut.edu.tw

(ITO)-based ammonia senor successfully.

摘要

本研究已經成功地使用氧化銦錫 (Indium Tin Oxide,簡稱 ITO)在透明基板 上製作氨氣感測器,此外我們還開發一種 演算法,利用其感測特性來有效率地減少 傳輸中的感測數據。

本研究製作之氨氣感測器感測濃度 可達 ppm 等級。藉由分析感測資料可以 知道在感測不同氨氣濃度時,感測介面空 缺情況。此外,經由一階微分演算法運算, 可在不改變氨氣感測特性下減少超過 95%的冗餘感測資料,此一結果可應用在 感測傳輸上。

關鍵字: 氨氣感測器、ITO、一階微分、 冗餘資料、感測傳輸

Abstract

We have fabricated an Indium Tin Oxide

In addition, we also developed an algorithm combined with the concept of first-order equation. The algorithm can reduce the gas sensing data effectively.

Our studied ammonia sensor can detect the ammonia gas concentration of ppm level. By analyzing the sensing data, we can find the vacancy variation of sensing interface at different ammonia concentration. By using the first-order different algorithm, the can be reduced 95% sensing data redundancy dat without change the ammonia gas sensing characteristics. The experimental results have potential in the sensing transmission.

Keywords: ammonia sensor > a first-order differential, redundancy data, sensing transmission.

一、前言

近年來,因為公共安全以及環保意識 抬頭,許多感測器被相繼提出[1-3],其中 又以半導體氣體感測器因為體積小、價格 便宜以及廣闊的應用等優勢而被大量研 究。

氨(NH3)可以做為清潔用品和藥品的 添加物,也可以使用在航空燃料和製冷劑 上,更常添加在染料、塑料、肥料的生產。 因此被廣泛應用在生產肥料、製冷系統、 商業清潔產品以及醫療業。但是氨(NH3) 有高度水溶性、無色鹼性的強烈刺激性氣 體,會嚴重刺激人體黏膜組織。當人體暴 露在環境時只要 50ppm 就會刺激人體 皮膚,眼睛和呼吸系統。於 500ppm 時會 強烈刺激鼻子和喉嚨。若在 1000ppm 或 更高的濃度的氨氯環境中,將會產生肺水 腫現象。當氨氣濃度為 5000ppm 或更高 濃度時,人體會在 5-10 分鐘內因喉頭水 腫而窒息死亡。因此,建立一個可靠的靈 敏的氨氟體傳感器達到可持續監測在環 境中的氨氣濃度是必要的。

近幾年來,透明導電氧化物(TCO) 薄膜在平板和液晶顯示器,太陽能電池, 以及光電探測器等的應用已經引起相當 多的關注。而ITO 是一種混和物,由銦氧 化物(In₂O3)與錫氧化物(SnO₂)混合而成, 通常混和比例為9比1,其在塊狀時呈現 黃灰色,在薄膜時呈現透明無色。ITO 是 具有寬能隙(3.5-4.06 電子伏特)n-型半 導體。相對於其他的 TCO 薄膜,ITO 薄 膜還具有光滑的表面形態和優異的導電 性和光學透明性。

本研究將以ITO 為感測層,製作 一 氨氟感測器,並找出減點傳輸方法,去除 冗餘資料以利感測資料傳輸。本研究將提 出基於一階微分概念之演算法達到減少 傳輸資料量。實作上使用半導體參數量測 儀 4155B 接收氨氟濃度的所有數據加以 儲存。本研究中量測氨氟濃度為 1ppm, 35ppm, 100ppm, 200ppm, 500ppm 以及 1000 NH 3 /air, 量測溫度為 150°C。演算 法以 Matlab 軟體分別對於不同氨氟濃度 的數據加以撰寫與評估。

二、實驗方法

(一)氨氟感測器製作

> 氨氟感測器的製造主要包括四個部分:(I)基底製備,(Ⅱ)電極沉積,(Ⅲ)ITO 薄膜沉積,和(IV)定義感測區域。

傳統的顯影法,濺射,熱蒸鍍和剝離技術 也被應用在製造過程。基於透明薄膜氧化 物之氫氣感測器如圖一所示。首先以藍寶 石基板為底,使用鉻金屬與白金金屬以黃 光微影技術製作指叉電極,金屬沉積厚度 約 10⁻⁷ 公尺(100 Å),接著再進行一次黃光 微影並使用射頻濺鍍法鍍上一層銦錫氧 化物透明導電薄膜作為感測薄膜。

(二)威測資料傳輸

在氣體感測中,常常因需感測空間大, 步驟二:將一階微分所得到數值,抓取不 使得所需的感测系統數量需求大,同樣這 些感測數據將因感測系統數量以及監測 時間拉長而產生大量數據[4-6],如何保有 數據的特性且能達到去除冗餘資料和資 料傳輸為即時且實際之問題,本研究將利 用微分方程式將收集到的數據統整後, 簡 化多餘數據,且能夠跟原來的數據資料量 所呈現的圖形特徵相同。



圖1、氨氟感測器橫截面圖

在一個長時間感測該地區是否有發 生異常,往往會把感測到的數據收集與統 整,經過長時間的收集數據,會使得資料 量過於龐大與某些資料多餘,所以我們本 研究數據簡化方法亦歸納如下:

步驟一、將原始數據做一階微分,表示如 下式:

$$f(k) = \{x_0 \circ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n\}$$
(1)
$$y(k) = f'(k)$$

為0的數值,如下式:

$$y(k) = f'(k) \cdot y(k) \neq 0$$
(2)

步驟三:將一階微分所得數值分類為正數 值P(x)以及負數值N(x),如下式: $p(k) = y(k) \cdot y(k) > 0$ $\mathbf{n}(\mathbf{k}) = \mathbf{y}(\mathbf{k}) \cdot \mathbf{y}(\mathbf{k}) < 0$ (3) 步驟四:分別抓 $P_{(X)}$ 以及 $N_{(X)}$ 中的最大值, 如下式:

$$P_{max} = f(p(k)), p(k) > 0$$

 $N_{max} = f(p(k)), p(k) < 0$ (4)
步驟五、分別以 P_{max} 為氣體濃度上升的主
要依據取相對鄰界值, N_{max} 為氣體濃度
下降的主要依據取相對臨界值,並分別簡
化數據。
步驟六整合步驟五所得資料,可得簡化後

之完整數據,該數據簡化流程如圖2所示。



圖 2、數值簡化流程圖

三、結果與討論

在ITO透明導電薄膜上氣體感測機制 說明如下,在空氣中,氧分子可以吸附在 於n-型半導體金屬氧化物ITO表面。然後, 被吸附的氧分子從 ITO 帶捕獲電子而且 改變為 O- 或 O2- 的氧離子。氧的吸附 反應可表示如下:

$$O_{2(g)} + e^- \to O_{2(abs)}^-$$
 (5)

$$O_{2(abs)}^{-} + e^{-} \rightarrow 2O_{(abs)}^{-} \tag{6}$$

其中O_{2(g)}是空氣中氧分子,並O_{2(abs)} 和O_(abs)是吸附在 ITO 表面上的氧離子, e⁻是電子電荷。所捕獲的電子造成 ITO 的 表面空乏層寬度增加,並導致載子濃度降 低。因此,ITO 的電阻將增加。當 ITO 被 暴露於氨氣,氨分子和氧離子之間的反應 可以如下列方程式表示:

2NH₃ + 30⁻_(abs) → N₂ + 3H₂O + 3e⁻ (10) 電子從價帶被釋放至導帶,因此ITO

的載子濃度增大,ITO 的電阻降低。

圖 3(a)、4(a)、5(a)、6(a)、7(a)以及 8(a)分別是感測到氨氣濃度為 1ppm, 35ppm, 100ppm, 200ppm, 500ppm, 以及 1000ppm NH₃/air的暫態響應圖,本研究 所製作之氨氣感測器均可以感測到完整 之氨氣暫態反應。由這些圖中可以發現當 氨氣濃度為 1ppm 以 35ppm NH₃/air時, 感測飽和曲線逐步上升,此時代表具有較 多的氧空缺等待 填 補,當氨氣濃度為 100ppm 以及 200ppm NH₃/air時,吸附與 脫附達到平衡,因此感測飽和曲線呈現平 衡狀態。當氨氣濃度為 500ppm 以及 1000ppm NH₃/air時, 氨氣進入 ITO 介面 比氧的空缺數多,因此會造成感測飽和曲 線過衝的現象。圖 3(b)、4(b)、5(b)、6(b)、 7(b)以及 8(b),分別是感測氨氣濃度的斜 率差,由這些圖中我們可以清楚得知,在 200ppm NH₃/air以下,斜率最大值皆發生 於氨氣導入時。當導入氨氣濃度為 500ppm 以及 1000ppm NH₃/air高濃度 時,斜率的最大值發生在飽和轉折處。最 大斜率的發生處將是本研究減點運算的 重要指標。我們將在下一段特別討論。

圖 3(c)、4(c)、5(c)、6(c)、7(c)以及 8(c)分別是圖 3(a)、4(a)、5(a)、6(a)、7(a) 以及 8(a)的暫態響應資料經過減點後所得 到的新暫態圖,有這些圖中可以得知傳輸 資料已經有明顯減少,這將有利資料傳輸 以及節省能源。這在商業應用上相當重 要。

有關減點的運算敘述如下,首先,將 要處理檔案中所有數據分成 10 等份,接 著將檔案中數據做一階微分,將一階微分 後值與前值相比未變化的數值去除(差值 為 0 者),並將數值區分類成正、負變化 率(差值>0 為正;差值<0 為負),下一步 計算出正、負斜率最大值,利用正、負斜 率最大值來取得氣體濃度上升、下降時臨 界值的各點數。接著將點數各數相加判斷 數量,若總點數小於300則直接排列其點 順序。若總點數介於100到300之間,則 判斷正、負臨界值點數,正或負點數大於 100則將正或負點數除50取整數減少整體 點數後排列點順序。相同的,總點數大於 300 則除 80 取整數後排列。將排列完的數 带回原值,形成我們所簡化的數據圖。

該數值簡化模擬中除了判斷氨氣

濃度在於變化時進行判斷濃度上升與 下降時的變化程度,且在不同氨氣濃 度的數值簡化各數點也會以變化程度 加以判斷曲線變化。除此之外,也觀 察並分析其是否能跟原數值之變化曲 線相同之。表 1 為模擬數值簡化與原 始數據的個數點比較。由實驗數據得 知,減少點數超過 95%,且不影響氨 氟感測特性。







圖 6 (b)氨氯 200ppm 斜率差





表1原始數值與簡化數值比較表

數值點數 氫氣濃度值	原始數值 點數	簡化後數值 點數
1ppm	4906	184
35ppm	4906	179
100ppm	4906	178
200ppm	4906	172
500ppm	4906	198
1000ppm	3449	182

四、結論

我們已經成功製作了以 ITO 為基礎之氣 氣感測器,並提出一個新的傳輸檢點方法, 運用以一階微分方程為基礎氨氣傳輸方 法,可在不改變傳輸特性下,減少超過 95%的感測資料。

致謝

本計畫感謝國科會計畫支持。國科會計畫 編號:101-2221-E-324-025-

參考文獻

- W. J. Buttner, G. J. Maclay, and J. R. Stetter, "Microfabricated amperometric gas sensors," Electron Devices, IEEE Transactions on , Vol. 35,pp. 793 –799, 1988.
- [2] S. R. Morrison, "Semiconductor Gas Sensors," Sens. Actuators, Vol. 2, pp. 329-341, 1982.
- [3] Kun-Wei Lin, Huey-Ing Chen, Hung-Ming Chuang, Chun-Yuan Chen, Chun-Tsen Lu, Chin-Chuan Cheng, Wen-Chau Liu, "Characteristics of Pd/InGaP Schottky diodes hydrogen sensors, " IEEE Journal of Sensors, vol. 4, pp.72-79, 2004.
- [4] C. Christofide and A. Mandelis,
 "Solid-state sensors for trace hydrogen gas detection" J. Appl. Phys., Vol. 68, No. 6, pp. 1–30, Sep. 1990.
- [5] Yamazoe and N. Miuta, "Development Of gas sensors for environmental

protection," Components, Package, and Manufacturing, IEEE Transactions on, Vol. 35, pp. 793–799, 1995.

- [6] A. Dittmar and K. Najafi "Special topic section on microtechniques, microsensors, microactuators, and microsystems," IEEE Trans. Biomed. Eng., Vol. 47, No. 1, pp. 1–2, Jan. 2000.
- [7] Alireza Salehi, and Moharam Gholizadeh "Selectivity Enhancement of MOSFET Hydrogen Sensor With Transparent ITO Gate" IEEE Journal of Sensors, vol. 11, No.5 pp.1201-1205, 2011.
- [8] S. J. Chang, T. K. Ko, Y. K. Su, Y. Z. Chiou, C. S. Chang, S. C. Shei, J. K. Sheu, W. C. Lai, Y. C. Lin, W. S. Chen, and C. F. Shen "GaN-Based p-i-n Sensors With ITO Contacts" IEEE Journal of Sensors, vol. 6, No.2 pp.406-411, 2006.